日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年12月 3日

出願番号

Application Number:

特願2001-368155

[ST.10/C]:

[JP2001-368155]

出 願 Applicant(s): 人

it(s): 花王株式会社

2002年 1月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

101K0235

【提出日】

平成13年12月 3日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C07C233/36

A61K 7/06

【発明者】

【住所又は居所】

和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社研究所内

【氏名】

井上 勝久

【発明者】

【住所又は居所】

和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社研究所内

【氏名】

香春 武史

【発明者】

【住所又は居所】

和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社研究所内

【氏名】

加藤 徹

【特許出願人】

【識別番号】

000000918

【氏名又は名称】

花王株式会社

【代理人】

【識別番号】

100063897

【弁理士】

【氏名又は名称】

古谷 馨

【電話番号】

03(3663)7808

【選任した代理人】

【識別番号】

100076680

【弁理士】

【氏名又は名称】

溝部 孝彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100087642

【弁理士】

【氏名又は名称】 古谷 聡

【選任した代理人】

【識別番号】 100091845

【弁理士】

【氏名又は名称】 持田 信二

【選任した代理人】

【識別番号】 100098408

【弁理士】

義経 和昌 【氏名又は名称】

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2001-60559

【出願日】

平成13年 3月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010685

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9812859

【包括委任状番号】 0007905

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 毛髪化粧料

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)で表されるアミン(以下アミン(I)という)を含有する毛髪化粧料。

【化1】

$$\left(R^{1} - N - C - R^{2}\right)_{p} N \left(R^{3}\right)_{q} \qquad (I)$$

[式中、 R^1 は炭素数 $8\sim 4$ 0の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基、或いは式 R^5 O - $(AO)_n$ - C_m H_{2m} - $(R^5$ は炭素数 $8\sim 4$ 0の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基、Aは炭素数 $2\sim 3$ のアルキレン基、nは平均値で $0\sim 3$ 0の数、mは $2\sim 3$ の整数、n個のAは同一でも異なってもよい)で表される基、 R^2 は炭素数 $1\sim 5$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキレン基、 R^3 は水素原子、炭素数 $1\sim 2$ 4 の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基、アルケニル基又はヒドロキシアルキル基、或いは炭素数 $6\sim 2$ 8 のアリール基又はアリールアルキル基、R 4 は水素原子、炭素数 $1\sim 5$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基、アルケニル基又はヒドロキシアルキル基、或いは炭素数 $6\sim 2$ 8 のアリール基又はアリールアルキル基又はヒドロキシアルキル基、或いは炭素数 $6\sim 2$ 8 のアリール基又はアリールアルキル基を示し、 R^3 と R^4 は単独或いは結合して環を形成してもよい。Pは $1\sim 3$ の整数、P0 のを数で、P1 中中中でも異なっていても良い。

【請求項2】 一般式(I)において、 R^1 が炭素数 $12\sim24$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基、或いは式 R^5 O $-(AO)_n$ $-C_m$ H_{2m} $-(R^5$ は炭素数 $12\sim24$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基、A、n及びmは前記の意味を示す)で表される基、 R^2 が炭素数 $1\sim3$ の直鎖アルキレン基、 R^3 及び R^4 が炭素数 $1\sim3$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアリールア

ルキル基(R^3 と R^4 は単独或いは結合して環を形成してもよい)、pが1又は2、q及びrが0又は1である請求項1記載の毛髪化粧料。

【請求項3】 無機酸及び有機酸からなる群から選ばれる少なくとも1種の酸を含有する請求項1又は2記載の毛髪化粧料。

【請求項4】 炭素数10~30のアルコールを含有する請求項1~3のいずれかに記載の毛髪化粧料。

【請求項5】 アミン(I)の含有量が0.1~15重量%、酸の含有量がアミン(I)に対し0.3~10モル倍、炭素数10~30のアルコールの含有量が0.5~15重量%である請求項4記載の毛髪化粧料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、毛髪に対して温潤時の十分な柔軟性や平滑性、更には油性感と、乾燥後の滑らかさ及び柔らかさ、櫛通りのよさを付与することができ、環境に対する安全性に優れる毛髪化粧料に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

毛髪化粧料には、毛髪に対して湿潤時の柔軟性や平滑性、油性感と乾燥後の滑を らかさ及び柔らかさ、櫛通りのよさを付与することが求められている。このよう な要求から、従来は、界面活性剤として長鎖アルキル基を有する第四級アンモニウム塩、例えばステアリルトリメチルアンモニウムクロライドやジステアリルジ メチルアンモニウムクロライド等が用いられている。しかしながら、これらは毛 髪の湿潤時と乾燥後の使用感を十分に満足するものではない。

[0003]

特開平5-271035、特開平5-271036及び特表平2000-501430号には第3級アミン型であるアミドアミンの塩を毛髪化粧料の基剤として使用することが開示されているが、上記の要求を十分に満足するものではなく、乾燥後等の感触と湿潤時の平滑性及び油性感を両立できない等の欠点があった。

[0004]

本発明の課題は、毛髪に対して湿潤時の柔軟性や平滑性、油性感と、乾燥後の滑らかさ及び柔らかさ、櫛通りのよさを付与することができる毛髪化粧料を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明は、一般式(I)で表されるアミン(以下アミン(I)という)を含有する毛髪化粧料を提供する。

[0006]

【化2】

$$\begin{pmatrix}
R^{1} & \stackrel{H}{\longrightarrow} & \stackrel{\parallel}{\longrightarrow} & \\
R^{1} & \stackrel{H}{\longrightarrow} & \stackrel{\parallel}{\longrightarrow} & \\
 & \downarrow p & & \\
 & \downarrow R^{4} & \downarrow r
\end{pmatrix}_{r}$$
(1)

[0007]

[0008]

]

【発明の実施の形態】

アミン(I)において、 R^1 は炭素数10~28の直鎖若しくは分岐鎖のアル キル基又はアルケニル基、或いは式 $R^{5}O-(AO)_{n}-C_{m}H_{2m}-$ で表される基で 、 R^5 が炭素数10~28の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基 、A、n及びmが前記と同じ意味を示す基が好ましく、更に炭素数12~24の 直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基、或いは式 R 5 O - (AO), - C_mH_{2m} -で表される基で、 R^5 が炭素数 $1.2 \sim 2.4$ の直鎖若しくは分岐鎖のアル キル基又はアルケニル基、A、n及びmが前記と同じ意味を示す基が好ましく、 特に炭素数 $12\sim24$ の直鎖アルキル基、或いは式 $R^{5}O-(AO)_{n}-C_{m}H_{2m}-$ で表される基で、 R^5 が炭素数 $12\sim24$ の直鎖アルキル基、A、n及びmが前 記と同じ意味を示す基が好ましい。前記のnは、いずれも0~20が好ましく、 5以下が更に好ましい。 R^2 は炭素数 $1 \sim 3$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキレン 基が好ましく、炭素数1~3の直鎖アルキレン基がより好ましく、メチレン基が 特に好ましい。 R^3 は炭素数 $1 \sim 2$ 2 の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基、アル ケニル基又はヒドロキシアルキル基、或いは炭素数6~28のアリール基又はア リールアルキル基が好ましく、炭素数1~3の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基 又はヒドロキシアルキル基、或いは炭素数6~10のアリール基又はアリールア ルキル基がより好ましい。 R^4 は炭素数 $1\sim5$ の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル 基、アルケニル基又はヒドロキシアルキル基、或いは炭素数6~28のアリール 基又はアリールアルキル基が好ましく、炭素数1~3直鎖若しくは分岐鎖のアル キル基又はヒドロキシアルキル基、フェニル基或いはベンジル基がより好ましい 。 R^3 と R^4 が結合して環を形成する場合には、 R^3 と R^4 の総炭素数 $4\sim2.8$ が好 ましく、4~10が更に好ましく、5員環又は6員環が特に好ましい。pは1又 は2の整数が好ましい。 q 及び r は0 又は1 が好ましく、特に第3 級アミンが好 ましい。

[0009]

アミン(I) の合成法としては、式(II)

$$R^{1}-NH_{2} \qquad (II)$$

(式中、R¹は前記の意味を示す。)

で表されるアミン(以下アミン(II)という)とハロゲン化カルボン酸又はその

低級アルキルエステルや酸ハライドを場合によっては触媒を使用して反応させ、 次いで対応するアミン等を反応させる方法や、アミノ酸又はその誘導体とアミン (II) とを反応させる方法等によって得ることが出来る。

[0010]

本発明の毛髪化粧料は、無機酸及び有機酸からなる群から選ばれる少なくとも 1種の酸を含有することが好ましい。無機酸としては、塩酸、硫酸及びリン酸等 が挙げられ、有機酸としては、炭素数 1~5の有機酸が好ましく、酢酸、グリコール酸、乳酸、グルタミン酸、リンゴ酸、コハク酸等が具体的に挙げられるが、塩酸、硫酸、乳酸、グルタミン酸、リンゴ酸等が特に好ましい。

[0011]

本発明の毛髪化粧料を調製する場合、アミン(I)と酸を、別々に配合しても 良いし、アミン(I)の酸塩をあらかじめ形成させてから配合しても良い。

[0012]

本発明の毛髪化粧料は、さらに炭素数10~30の高級アルコールを含有することが好ましい。本発明に用いられる高級アルコールとしては、炭素数10~30の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基を有する高級アルコール類、好ましくは炭素数12~26の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基を有する高級アルコール、更に好ましくは、セタノール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、アラキルアルコール、ベヘニルアルコール、カラナービルアルコール、セリルアルコール等の高級アルコールが挙げられる。

[0013]

本発明の毛髪化粧料中のアミン(I)の含有量は、毛髪に良好な感触を与え、また保存時における沈殿、固化、分層等の製品安定性の観点から、 $0.1\sim15$ 重量%が好ましく、特に $0.3\sim8$ 重量%が好ましい。また、酸の含有量は、アミン(I)に対し $0.3\sim10$ モル倍が好ましく、特に $0.5\sim5$ モル倍が好ましい。さらに、高級アルコールの含有量は、柔軟性、しっとり感を発揮し、また製品の安定性の観点から、 $0.5\sim15$ 重量%が好ましく、特に $1\sim10$ 重量%が好ましい。

[0014]

本発明の毛髪化粧料は、配合物中でpHを調整することにより、アミン(I) の一部もしくは全部を塩の形に置換して使用されるが、pH2~8、特にpH3~6で使用するのが、毛髪の良好な感触、また製品の安定性の観点から好ましい

[0015]

本発明の毛髪化粧料には、他の陽イオン界面活性剤や陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤等の界面活性剤、シリコーン、炭化水素、ラノリン誘導体、高級脂肪酸エステル類、高級脂肪酸類、油脂類、グリセリン、保湿剤、カチオン性ポリマー、多糖類、ポリペプタイド、パール化剤、溶剤、液晶形成剤、芳香族スルホン酸類、色素、香料、噴射剤、キレート剤、pH調整剤、防腐剤、抗フケ剤等を本発明の目的を損なわない範囲内で適宜配合することができる。

[0016]

本発明の毛髪化粧料は、水溶液、エタノール溶液、エマルション、サスペンション、ゲル、液晶、エアゾール等の所望の剤型にすることができる。

[0017]

本発明の毛髪化粧料は、ヘアリンス、ヘアコンディショナー、ヘアトリートメント、ヘアパック、ヘアクリーム、コンディショニングムース、ヘアムース、ヘアスプレー、シャンプー、リーブオントリートメント等に用いることができる。

[0018]

【実施例】

例中の%は、特記しない限り重量%である。

[0019]

合成例1

攪拌機、温度計、脱水管、窒素導入管を具備した4つロフラスコに、ファーミン80(花王(株)製のアルキル1級アミン)801.9gとN,Nージメチルグリシンエチルエステル413.2gを仕込み、触媒として28%ナトリウムメチラートのメタノール溶液11.6gを添加して、100℃、3時間で生成するエタノールを留去しながら反応させた後、キョウワード600S(協和化学工業

(株) 製) 21.3 g を添加して触媒吸着、濾過除去を行い、表1に示すアミンA 1036.1 g を得た。

[0020]

合成例2

攪拌機、温度計、脱水管、滴下ロートを具備した4つロフラスコに、ニッサンアミンVBS(日本油脂(株)製のアルキル1級アミン)325.6g、メタノール900g、触媒として28%ナトリウムメチラートのメタノール溶液3.9gを入れ、15~20℃に保ちながらクロロ酢酸メチルエステル113.9gを1時間で滴下した後、30時間反応させた。反応後、析出してきた結晶を濾過し、さらにメタノール300gで洗浄を行い、乾燥後、対応するクロロアセトアミド378.0gを得た。

[0021]

次に、攪拌機、温度計、冷却管を具備した4つロフラスコに、上記のクロロアセトアミド201.0gとジエチルアミン219.4g、イソプロピルアルコール500gを入れ、50℃で5時間反応させた。反応後、48%水酸化ナトリウム水溶液41.7g、イオン交換水100gを添加した後、減圧下で過剰のジエチルアミンと溶媒を留去した。更に、脱塩、アセトンによる晶析を行い、乾燥後、表1に示すアミンB 201.8gを得た。

[0022]

合成例3

攪拌機、温度計、脱水管、窒素導入管を具備した4つロフラスコに、ファーミン20(花王(株)製のアルキル1級アミン)370.7gとN-メチルイミノジ酢酸147.1gを仕込み、180℃、10時間で生成する水を留去しながら反応させた後、アセトン晶析を行い、乾燥後、表1に示すアミンC 476.4gを得た。

[0023]

合成例4

ニッサンアミンVBSの代わりにファーミン86T(花王(株)製のアルキル1級アミン)258.2gを使用した以外は、合成例2の原料、条件で対応する

クロロアセトアミド316.0gを得た。

[0024]

次に、攪拌機、温度計、冷却管を具備した4つロフラスコに、上記のクロロアセトアミド167.3gとメチルエタノールアミン187.8g、メタノール500gを入れ、35~45℃で13時間反応させた。反応後、48%水酸化ナトリウム水溶液41.7gを添加した後、減圧下で過剰のメチルエタノールアミンと溶媒を留去した。更に、脱塩、アセトンによる晶析を行い、乾燥後、表1に示すアミンD 328.5gを得た。

[0025]

【表1】

アミン A	O H H H H I CH ₃ だ度99.6%(その他:アルキル1級アミン、ジメチルグリシン等) (R: C ₁₆ H ₃₃ /C ₁₇ H ₃₅ /C ₁₈ H ₃₇ /C ₁₉ H ₃₉ /C ₂₀ H ₄₁ =4%/1%/93.5%/0.5%/1%)
アミン B	O H R-N-C-CH ₂ -N CH ₂ CH ₃ 純度98.5%(その他:アルキル1級アミン、ジエチルグリシン、NaCl等) (R: C ₁₈ H ₃₇ /C ₂₀ H ₄₁ /C ₂₂ H ₄₈ /C ₂₄ H ₄₈ =4%/12%/82%/2%)
アミン C	O R—N—C—CH ₂ 、 H R—N—C—CH ₂ N—CH ₃
	(R: C ₁₀ H ₂₁ /C ₁₂ H ₂₅ /C ₁₄ H ₂₉ =1%/96%/3%)
アミン D	H CH ₂ CH ₂ OH R—N—C—CH ₂ -N CH ₃ CH ₃ (その他:アルキル1級アミン等) (R: C ₁₄ H ₂₈ /C ₁₈ H ₃₃ /C ₁₈ H ₃₇ =4%/30%/66%)

[0026]

実施例1~8及び比較例1~2

合成例1~4で得られた本発明に係わるアミンA~D、又は表2に示す比較化合物Y(東京化成工業(株)製のトリメチルステアリルアンモニウムクロライド)、比較化合物Z(日光ケミカルズ(株)製のNIKKOLアミドアミンMPS)を用い、表3及び表4に示す組成のヘアリンス剤を常法により製造した。これらのヘアリンス剤について、下記の方法により評価を行った。結果を表3及び表4に示す

[0027]

【表2】

比較化合物 Y	CH_3 $ _+$ $C_{18}H_{37}$ — N — CH_3 CH_3 Cl^-
比較化合物 Z	$C_{17}H_{35}-C-N-C_{3}H_{6}-N$ $C_{17}H_{35}-C-N-C_{3}H_{6}-N$ $C_{17}H_{35}-C-N-C_{3}H_{6}-N$

[0028]

<評価方法>

・乳化性

ヘアリンス剤を製造後、室温(25℃)、3時間放置後の乳化状態を下記基準で評価した。

[0029]

〇;乳化ゲルが安定に保たれている

 Δ ;若干分離

×;分離

・乳化物保存安定性

ヘアリンス剤の保存の加速試験として50℃、3週間保存して、ゲル乳化状態

を下記基準で評価した。

[0030]

〇;乳化ゲルが安定に保たれている

 Δ ;若干分離

×;分離

・毛髪への塗布時、濯ぎ時及び乾燥後の性能

コールドパーマ等の化学処理をしたことのない日本人女性の毛髪20g(長さ20cm, 平均直径60 μ m)を束ね、シャンプー5gを用いて洗浄した。このシャンプー組成は、ポリオキシエチレンアルキル(炭素数12)エーテル硫酸ナトリウム(エチレンオキシド平均付加モル数2.5)15%、ジエタノールアミド3%、残部は水である。

[0031]

その後、調製したヘアリンス剤の50℃、3週間保存品2.0gを均一に塗布 し、30秒間約40℃の流水で濯いだ。この塗布時、濯ぎ時のリッチ感とその持 続性、柔軟性、平滑性、及び乾燥後の柔らか感、櫛通り感について、専門パネラ -5人で、下記基準で官能評価した。

[0032]

A; 4人以上が効果あると回答。

B;3人が効果あると回答

C:2人が効果あると回答

D;1人以下が効果あると回答

[0033]

【表3】

				実力	比 較 例			
		,	1	2	3	4	1	2
	アミン (I)		A 1.5	B 1.5	C 1.5	D 2.0		
アリ	比較化合物			_	_	_	Y 1.0	Z 1.5
ンス	塩酸(対	アミンモル比)			0.5	_	_	0.7
剤	乳酸(対	アミンモル比)	1.5	1.0	0.7	0.7	_	_
配合	セチルアルコール		1	1	1 ·	1	1	1
組	ステアリルアルコール		3	2	2	1	2	2
成	ヘ・ヘニルアルコール		1	2	1	3	1	<u>.</u> 1
	流動パラフィン		2	3	1	3	3	3
%	ジメチルポリシロキサン*		3	2	1	2	3	2
~	クエン酸(pH調整剤)		適量	適量	適量	適量	適量	適量
	精製水		パランス	パランス	パランス	パランス	バランス	バランス
	рΗ		4	5	3	4.5	4	6
	乳化性		0	0	0	0	0	0
	乳化物保存安定性		0	0	0	0	Δ	Δ
評		リッチ感	Α	· A	Α	Α	D	С
価	塗布、	持続性	В	Α	В	Α	C.	В
結果	濯ぎ時	柔軟性	. А	В	С	В	В	C ·
*		平滑性	В	Α	Α	В	С	В
	乾燥後	柔らか感	. A	Α	В	Α	В	В
	千七八木1文	櫛通り感	В	В	B	В	С	В

^{*:}信越化学工業(株)製 KF96A-5000cs

[0034]

【表4】

			実 施 例			
			5	6	7	8
ヘアリ	アミ	ン (1)	A 1.7	A 1.5	B 2.0	B 2.0
ソンス剤配合組成	酸(対アミンモル比)		硫酸 0.5	グルタミン酸 1.5	リンコ [*] 酸 3	塩酸 1
配	ステアリル	レアルコール	4	5	5	6
台組	流動	パラフィン	2	2	2	2
1 1	ジメチルポリシロキサン [*]		2	2	2	3
%	リン酸(pH調整剤)		適量	適量	適量	適量
<u> </u>	精製水		パランス	バランス	ハランス	バランス
	рH		3	4.5	4	3.5
	乳化性		0	0	0	0
	乳化物保存安定性		0	0	0	0
評	塗布、濯ぎ時	リッチ感	Α	Α	Α	· A
価		持続性	В	В	Α	В
結果		柔軟性	Α	Α.	В	Α
		平滑性	В	В	Α	Α
	乾燥後	柔らか感	Α .	В	Α	Α
	千七次 1文	櫛通り感	В	Α	Α	В

^{*:}信越化学工業(株)製 KF96A-5000cs

[0035]

合成例5

攪拌機、温度計を具備したオートクレーブに、カルコール6850(花王(株)製の高級アルコール)256.5gと水酸化カリウム0.1gを入れ、温度120℃、真空度2.6kPaで1時間の脱水を行った後、60℃の温度まで冷却してアクリロニトリル58.4gを1時間かけて導入し、1時間保持して反応を完結させた。次に、ラネーニッケル1.9gと水酸化ナトリウム0.3g、イオン交換水16.1gを入れ、130℃の温度で水素化還元反応を3時間で行った後、濾過して触媒を除去した。さらに、蒸留精製して対応するエーテル1級アミン288.5gを得た。

[0036]

次に、攪拌機、温度計、脱水管、窒素導入管を具備した4つロフラスコに、上記エーテル1級アミン156.8gとN,Nージメチルグリシン61.9gを仕込み、180℃まで昇温した。生成する水を留去しながらそのままの温度で8時間反応させた後、アセトンによる晶析を行い、乾燥後、表5に示すアミンE 159.5gを得た。

[0037]

合成例6

カルコール6850の代わりにオクタデカノールのエチレンオキサイド平均3.1 モル付加物407.1 gを使用し、蒸留精製は行わなかった以外は合成例5と同様の原料と条件で対応するエーテル1級アミン445.6を得た。

[0038]

次に、攪拌機、温度計、脱水管、窒素導入管を具備した4つロフラスコに、上記のエーテル1級アミン232.1 gとN, N-ジメチルグリシン72.2 gを 仕込み、190 Cまで昇温した。生成する水を留去しながらそのままの温度で8 時間反応させた後、水洗により過剰のN, N-ジメチルグリシンを除去し、表5 に示すアミンF 297.1 gを得た。

[0039]

合成例7

ニッサンアミンVBSの代わりにファーミン80(花王(株)製のアルキル1級アミン)267.3gを使用した以外は、合成例2の原料、条件で対応するクロロアセトアミド323.2gを得た。

[0040]

次に、攪拌機、温度計、冷却管を具備した4つロフラスコに、上記のクロロアセトアミド138.4gとピロリジン170.69g、イソプロピルアルコール400gを入れ、40℃で6時間反応させた。反応後、48.3%水酸化ナトリウム水溶液33.1g、イオン交換水50gを添加しした後、減圧下で過剰のピロリジンと溶媒を留去した。更に、脱塩、アセトンによる晶析を行い、乾燥後、表5に示すアミンG 108.3gを得た。

[0041]

合成例8

攪拌機、温度計、冷却管を具備した4つロフラスコに、合成例7と同様の方法で得たクロロアセトアミド138.4gとNーメチルアニリン257.2g、イソプロピルアルコール395gを入れ、60~70℃で30時間反応させた。反応後、48.3%水酸化ナトリウム水溶液33.1g、イオン交換水80gを添加しした後、減圧下で過剰のNーメチルアニリンと溶媒を留去した。更に、脱塩、アセトンによる晶析を行い、乾燥後、表5に示すアミンH 132.7gを得た。

[0042]

【表5】

[0043]

実施例9~12、比較例3

合成例5~8で得られた本発明に係わるアミンE~H及び比較例2と同様の比較化合物Zを用い、表6に示す組成のヘアリンス剤を常法により製造した。これらのヘアリンス剤について実施例1と同様の方法で評価を行った。結果を表6に示す。

[0044]

【表6】

	実施例					比較例	
			9	10	11	12	3
^ 7	アミン (1)		E 1.5	F 1.5	G 1.5	H 1.5	_
アリン	比較化合物		—		_	– .	Z´ 1.5
ス剤配	グルタミン酸 (対アミンモル比)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
合	セタノール*1		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
組	パルミチン酸イソプロピル		2	2	2	2	2
成	ジメチルポリシロキサン*2		2	2	2	2	2
	プロピレングリコール		1	1.	1	1-	1
% ~	クエン酸(pH調整剤)		適量	適量	適量	適量	適量,
	精製水		パランス	パランス	ハランス	バランス	ハランス
	рН		4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	乳	化性	0	0	0	0	0
,	乳化物保存安定性		0	0	0	0	0
評		リッチ感	Α	Α	В	В	С
一価	塗布、 濯ぎ時	持続性	Α	Α	Α	Α	С
結果		柔軟性	Α	Α	Α	Α	В
未		平滑性	А	А	В	В	В
	th kg 46	柔らか感	Α	В	Α	В	В
	乾燥後	櫛通り感	Α	· A	В	В	В

*1: セタノールは、セチルアルコール/ステアリルアルコールの重量比7/3の混合物である。 以下同じ。

*2: 信越化学工業(株)製 KF96A-5000cs

[0045]

実施例13

下記組成のヘアリンス剤を製造した。

[0046]

アミンA

3.0%

乳酸

2.0%

セタノール

4.0%

j	パルミチン酸イソプロピル	2.	0 %
3	ジメチルポリシロキサン(平均分子量9000)	1.	0 %
7	ポリエーテル変性シリコーン(信越化学工業製KF6015)	2.	0 %
-	プロピレングリコール	1.	5 %
ļ	50%クエン酸水溶液	0.	2 %
ī	香料、メチルパラベン	適	量
¥	情製水	バラ	ンス

(pH3.5)

このリンス剤は、ゲル状に乳化し、乳化物の保存安定性も良好であった。さらに、塗布時、濯ぎ時のリッチ感とその持続性、柔軟性、平滑性、及び乾燥後の柔らか感、櫛通り感も良好であった。

[0047]

実施例14

下記組成のヘアトリートメント剤を製造した。

[0048]

アミンB	2.5%
3 5 %塩酸水溶液	0.7%
セタノール	6.5%
ジメチルポリシロキサン(平均分子量9000)	5.0%
モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン	0.5%
(エチレンオキサイド平均付加モル数20)	
ベヘン酸	0.1%
ジプロピレングリコール	6.0%
グリセリン	8.0%
50%クエン酸水溶液	0.2%
香料、メチルパラベン	適量
精製水	バランス

(pH3.5)

このヘアトリートメント剤は、ゲル状に乳化し、乳化物の保存安定性も良好で

あった。さらに、塗布時、濯ぎ時のリッチ感とその持続性、柔軟性、平滑性、及び乾燥後の柔らか感、櫛通り感も良好であった。

[0049]

実施例15

下記組成のヘアトリートメント剤を製造した。

[0050]

アミンE	2.	5 %
9 0 %乳酸	Ο.	9 %
セタノール	4.	0 %
ジメチルポリシロキサン ^{*1}	3.	0 %
アミノ変性シリコーン ^{*2}	0.	5 %
モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン	. O.	5 %
(エチレンオキサイド平均付加モル数20)		
流動パラフィン	2.	0 %
ジプロピレングリコール	3.	0 %
グリセリン	7.	0 %
50%クエン酸水溶液	0.	2 %
ヒドロキシエチルセルロース*3	0.	1 %
香料、メチルパラベン	適	量
精製水	バラ	ンス

(pH3.7)

- *1:信越化学工業(株)製 KF96A-5000cs
- *2: 東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製 アミノアルキルシリコーンエマルション SM8702C
- *3: ダイセル化学工業(株)製 SE-850

このヘアトリートメント剤は、ゲル状に乳化し、乳化物の保存安定性も良好であった。さらに、塗布時、濯ぎ時のリッチ感とその持続性、柔軟性、平滑性、及び乾燥後の柔らか感、櫛通り感も良好であった。

[0051]

特2001-368155

【発明の効果】

本発明の毛髪化粧料は、感触向上剤等の油剤等の乳化性が非常に良好で、且つ乳化したゲルの長期安定性に優れる。しかも、毛髪に対して湿潤時の良好なリッチ感とその持続性、柔軟性、平滑性、及び乾燥後の柔らかさ、櫛通りのよさを付与することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 毛髪に対して湿潤時の柔軟性や平滑性、油性感と、乾燥後の滑らか さ及び柔らかさ、櫛通りのよさを付与することができる毛髪化粧料の提供。

【解決手段】 一般式(I)で表されるアミンを含有する毛髪化粧料。 【化1】

$$\left(R^{1} - N - C - R^{2}\right)_{p} N \left(R^{3}\right)_{q} \qquad (I)$$

[式中、 R^1 は C_{8-40} のアルキル基又はアルケニル基、或いは式 R^5 O - (AO) $_n$ -C $_m$ H $_{2m}$ - (R^5 は C_{8-40} のアルキル基又はアルケニル基、Aは C_{2-3} のアルキレン基、 R^5 は R^5 0 の数、 R^5 0 で表される基、 R^5 0 によって、 R^5 1 によって、 R^5 1 によって、 R^5 2 には R^5 2 には R^5 3 には R^5 4 には R^5 6 によって、 R^5 7 によって、 R^5 8 によって、 R^5 8 によって、 R^5 9 によって、 R^5 9 には R^5 9

【選択図】 なし

認定 · 付加情報

特許出願の番号 特願2001-368155

受付番号 50101768858

書類名特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成13年12月 6日 3

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000000918

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100063897

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋浜町2丁目17番8号 浜町

花長ビル6階

【氏名又は名称】 古谷 馨

【選任した代理人】

【識別番号】 100076680

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋浜町2丁目17番8号 浜町

花長ビル6階

【氏名又は名称】 溝部 孝彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087642

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋浜町2丁目17番8号 浜町

花長ビル6階

【氏名又は名称】 古谷 聡

【選任した代理人】

【識別番号】 100091845

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋浜町2丁目17番8号 浜町

花長ビル6階

【氏名又は名称】 持田 信二

【選任した代理人】

【識別番号】 100098408

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋浜町2丁目17番8号 浜町

花長ビル6階

次頁有

認定・付加情報(続き)

【氏名又は名称】 義経 和昌

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

氏 名 花王株式会社